Original document

SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

Patent number:

JP2003086761

Publication date:

2003-03-20

Inventor:

TAWARA IWAO; NEGISHI YUJI; WAKIZAKA SHINJI

Applicant:

CASIO COMPUT CO LTD;; OKI ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

H01L25/065; H01L21/56; H01L25/07; H01L25/18

- european:

Application number: JP20010279062 20010914

Priority number(s):

View INPADOC patent family

Abstract of JP2003086761

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device together with its manufacturing method capable of high-density mounting, with no degradation in manufacturing yield or reliability. SOLUTION: There are provided a flexible substrate 1a, and a rigid flex substrate 1 comprising a rigid substrate 1b which clamps the substrate 1a on both surfaces. An external connection terminal 3 is formed on one rigid substrate 1b while a semiconductor chip 2 is mounted on other rigid substrates 1b. With a flexible part 1c comprising the flexible substrate 1a bent, the semiconductor chips 2 mounted on the rigid substrates 1b are laminated and resin-sealed, to provide a reliable semiconductor substrate excellent in moisture-resistance. Using the rigid flex substrate 1 eliminates deflection or twisting of substrate, to prevent dislocation at chip mounting for the improved manufacturing yield.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Also published as:

团 JP2003086761 (A)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公閱番号 特開2003-86761 (P2003-86761A)

(43)公開日 平成15年3月20日(2003.3.20)

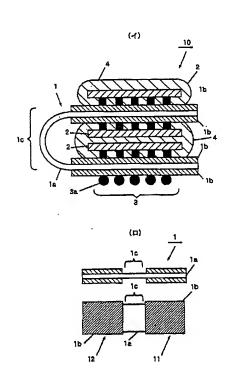
(51) Int.Cl. ⁷ H 0 1 L	25/065 21/56 25/07 25/18	酸別配号	FI H01L 21	デーマコート*(参考) 1/56 R 5 F 0 6 1 T 5/08 Z
			客查請求	未請求 請求項の数11 OL (全 12 頁)
(21)出廣番号		特願2001-279062(P2001-279062)	(71)出願人	カシオ計算機株式会社
(22)出願日		平成13年9月14日(2001.9.14)	(71) 出願人	東京都渋谷区本町1丁目6番2号 000000295 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
			(72)発明者	田原 伊和男 東京都八王子市東浅川町550番地の1 株 式会社アイ・イー・ピー・テクノロジーズ 内
			(74)代理人	
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 製造歩留りの低下や信頼性を損うこと無く高密度実装することができる半導体装置およびその製造方法を実現する。

【解決手段】 フレキシブル基板1 a と、この基板1 a の両面を挟み込むリジッド基板1 bを備えるリジッドフレックス基板1を備え、1つのリジッド基板1 b に外部接続端子3が形成され、他の各リジッド基板1 b に半導体チップ2が実装されて、フレキシブル基板1 a からなる可撓部1 c で屈曲させて各リジッド基板1 b にそれぞれ実装される各半導体チップ2を積層させて樹脂封止するので、耐湿性に優れた信頼性の高い半導体装置を実現できる。また、リジッドフレックス基板1を用いることで基板の撓みや振れがなくなり、チップ実装時の位置ずれを防ぎ、製造歩留りを向上させる。



[特許請求の範囲]

[請求項1] 屈曲自在なフレキシブル基板と、このフレキシブル基板の第1の領域の両面を挟み込む2枚のリジッド基板を備える第1のリジッド基板部と、前記フレキシブル基板の少なくとも1つの第2の領域の、少なくとも一方の面上に配設されるリジッド基板を備える第2のリジッド基板部とから構成されるリジッドフレックス基板を備え、

前記第1のリジッド基板部の、前記第2のリジッド基板部における前記リジッド基板と同じ側の一方のリジッド基板上に、少なくとも1つの第1の半導体チップが実装され、前記第1のリジッド基板部の、他方のリジッド基板上に外部接続端子が形成され、前記第2のリジッド基板部の前記リジッド基板に、少なくとも1つの第2の半導体チップが実装されていることを特徴とする半導体装置。

[請求項2] 前記リジッドフレックス基板の前記第1のリジッド基板部と前記第2のリジッド基板部間の前記フレキシブル基板を可撓部とし、該可撓部が屈曲されて、前記第1のリジッド基板部の一方のリジッド基板に 20 実装されている前記第1の半導体チップと、前記第2のリジッド基板部のリジッド基板に実装されている前記第2の半導体チップとが積層され、樹脂封止されていることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

[請求項3] 前記各リジッド基板にそれぞれ実装される各半導体チップは、突起電極を介して接続されるウェハレベルCSP構造を有することを特徴とする請求項1または請求項2記載の半導体装置。

【請求項4】 前記可撓部の屈曲に応じて対向する前記各リジット基板の内、前記第1のリジッド基板部の各リジッド基板の大きさを前記第2のリジッド基板部のリジッド基板の大きさより大きくしたことを特徴とする請求項2記載の半導体装置の製造方法。

【請求項5】 前記リジッドフレックス基板において、前記可撓部が2箇所以上形成され、該可撓部を介して、前記第2のリジッド基板部が前記第1のリジッド基板部に対して従属的に2箇所以上形成され、前記可撓部が屈曲されて、前記各リジット基板部の各リジッド基板に実装される各半導体チップが順次折畳まれるように積層されることを特徴とする請求項2記載の半導体装置。

【請求項6】 前記リジッドフレックス基板において、前記可撓部が前記第1のリジッド基板部の少なくとも2辺に形成され、該可撓部を介して、前記第2のリジッド基板部が前記第1のリジッド基板部に対して少なくとも2方向に形成され、前記可撓部が屈曲されて、前記各リジッド基板部の各リジッド基板に実装される各半導体チップが前記第1のリジット基板部上で順次折畳まれるように積層されることを特徴とする請求項2記載の半導体装置。

【請求項7】 前記第1のリジッド基板部の前記外部接

続端子が形成される他方のリジッド基板には外部接続端子形成用の端子パッドおよび配線パターンが形成され、前記各半導体チップが実装される一方のリジッド基板、および前記第2のリジッド基板部の前記リジッド基板には前記半導体チップ実装用の接続端子パッドおよび配線パターンが形成され、前記フレキシブル基板には所定の配線パターンが形成されて、

前記各リジッド基板部の各リジッド基板の前記端子バッドおよび接続端子バッドが前記フレキシブル基板の前記 配線バターンを介して相互に電気的に接続されていると とを特徴とする請求項1万6記載の半導体装置。

[請求項8] 屈曲自在なフレキシブル基板と、このフレキシブル基板の1つの第1の領域の両面を挟み込む2枚のリジッド基板を備える第1のリジッド基板部と、前記フレキシブル基板の少なくとも1つの第2の領域の、少なくとも一方の面上に配設されるリジッド基板を備える第2のリジッド基板部とから構成されるリジッドフレックス基板を複数連結したシート状の集合基板を用い、前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板におけ

る、前記第1のリジッド基板部の、前記第2のリジッド 基板部における前記リジッド基板と同じ側の一方のリジッド基板上に、少なくとも1つの第1の半導体チップを 実装するとともに、前記第2のリジッド基板部の前記リジッド基板に、少なくとも1つの第2の半導体チップを 実装する半導体チップ実装工程と、前記集合基板の前記 各リジッドフレックス基板における、前記第1のリジッド基板部の、他方のリジッド基板上に外部接続端子を形成する外部接続端子形成工程と、

前記半導体チップ実装工程および前記外部接続端子形成 工程後、前記集合基板に連結された前記各リジッドフレックス基板を個片化する個片化工程と、

個片化された前記各リジッドフレックス基板を、該リジッドフレックス基板の前記第1のリジッド基板部と前記第2のリジッド基板部間の前記フレキシブル基板を可撓部として、該可撓部で屈曲させて前記各リジッド基板に実装される前記各半導体チップを積層させて樹脂封止する封止工程と、

を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。

[請求項9] 屈曲自在なフレキシブル基板と、このフレキシブル基板の1つの第1の領域の両面を挟み込む2枚のリジッド基板を備える第1のリジッド基板部と、前記フレキシブル基板の少なくとも1つの第2の領域の、少なくとも一方の面上に配設されるリジッド基板を備える第2のリジッド基板部とから構成されるリジッドフレックス基板を複数連結したシート状の集合基板を用い、前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板における、前記第1のリジッド基板部の、前記第2のリジッド基板部における前記リジッド基板と同じ側の一方のリジッド基板上に、少なくとも1つの第1の半導体チップを実装するとともに、前記第2のリジッド基板部の前記リ

3

ジッド基板に、少なくとも1つの第2の半導体チップを 実装する半導体チップ実装工程と、

前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板における、前記第1のリジッド基板部の、他方のリジッド基板 上に外部接続端子を形成する外部接続端子形成工程と、前記半導体チップ実装工程および前記外部接続端子形成工程と、前記集合基板上の前記各リジッドフレックス基板において、前記第1のリジッド基板部を集合基板に連結させたまま、前記第2のリジッド基板部の前記リジッド基板を当該集合基板から裁断して分離する分離工程と

前記各リジッドフレックス基板の前記第1のリジッド基板部と前記第2のリジッド基板部間の前記フレキシブル基板を可撓部として、前記第2のリジッド基板部が前記集合基板から分離された状態の前記各リジッドフレックス基板を、前記可撓部でそれぞれ屈曲させて前記各リジッド基板に実装される前記各半導体チップを積層し、その状態で上下に対向する半導体チップに立を接着固定してなるモジュールを一括して樹脂モールドした後、前記第1のリジッド基板部の前記各リジット基板を集合基板から裁断してモジュール単位に個片化するモジュール形成工程と、

を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項10】 前記各リジッド基板にそれぞれ実装される各半導体チップは、突起電極を介して接続されるウェハレベルCSP構造を有することを特徴とする請求項8又は請求項9のいずれかに記載の半導体装置の製造方法

【請求項11】 前記モジュール形成工程では、上下に 対向する半導体チップ同士が接着固定された複数のモジュールを個々に覆う金型を用い、これにより全モジュールを一括して樹脂モールドすることを特徴とする請求項 9記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複数の半導体チップを高密度実装する半導体装置およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、中間基板を用いて複数の半導体チ 40ップを高密度実装するマルチチップモジュールが知られている。この種の技術として、例えば特開2000-307037号公報には、図10(イ)~(ハ)に図示するように、可提性を有するフレキシブル基板100上に、バンプ101を介して2つの半導体チップ102、102をフリップチップ実装し、その後にフレキシブル基板100を屈曲させて両チップ102、102の背面同士を当接させた状態で接着固定して積層し、屈曲させたフレキシブル基板100の接続バッド103に形成されるハンダボール104を介して配線基板に接続するよ 50

うにしたマルチチップモジュールが開示されている。 【0003】

【発明が解決しようとする課題】ところで、こうしたマルチチップモジュール構造の半導体装置では、可撓性のフレキシブル基板100を使用しているので、当該基板100に撓みや振れが生じ易い。この為、汎用のチップマウンタや基板搬送システムに適用し難い弊害や、とりわけ半導体チップ102をフェイスダウンで実装する際に位置ずれが起こり易くなる結果、製造歩留りの低下を招致するという問題がある。

【0004】また、上述のモジュール構造では、フレキシブル基板100の屈曲により積層される半導体チップ102の裏面同士が接着固定されるだけであって、さらにチップ周辺は露出状態にあるから耐湿性に欠け、信頼性低下を招致するという問題もある。

[0005] そとで本発明は、とのような事情に鑑みてなされたもので、汎用のチップマウンタや基板搬送システムに適用できる上、製造歩留りの低下や信頼性を損うと無く高密度実装することができる半導体装置およびその製造方法を提供することを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明では、屈曲自在なフレキシブル基板と、このフレキシブル基板の第1の領域の両面を挟み込む2枚のリジッド基板を備える第1のリジッド基板部と、前記フレキシブル基板の少なくとも1つの第2の領域の、少なくとも一方の面上に配設されるリジッド基板を備える第2のリジッド基板部とから構成されるリジッドフレックス基板を備え、前記第1のリジッド基板部の、前記第2のリジッド基板部における前記リジッド基板と同じ側の一方のリジッド基板に、少なくとも1つの第1の半導体チッブが実装され、前記第1のリジッド基板部の、他方のリジッド基板部の前記リジッド基板に、少なくとも1つの第2の半導体チップが実装されていることを特徴とする。

[0007]上記請求項1に従属する請求項2に記載の発明では、前記リジッドフレックス基板の前記第1のリジッド基板部と前記第2のリジッド基板部間の前記フレ キシブル基板を可撓部とし、該可撓部が屈曲されて、前記第1のリジッド基板部の一方のリジッド基板に実装されている前記第1の半導体チップと、前記第2のリジッド基板部のリジッド基板に実装されている前記第2の半導体チップとが積層され、樹脂封止されていることを特徴とする。

[0008] 上記請求項1または請求項2に従属する請求項3に記載の発明では、前記各リジッド基板にそれぞれ実装される各半導体チップは、突起電極を介して接続されるウェハレベルCSP構造を有することを特徴とする。

【0009】上記請求項1に従属する請求項4に記載の発明では、前記可撓部の屈曲に応じて対向する前記各リジット基板の内、前記第1のリジッド基板部の各リジッド基板の大きさを前記第2のリジッド基板部のリジッド基板の大きさより大きくしたことを特徴とする。

【0010】上記請求項1に従属する請求項5に記載の発明では、前記リジッドフレックス基板において、前記可撓部が2箇所以上形成され、該可撓部を介して、前記第2のリジッド基板部が前記第1のリジッド基板部に対して従属的に2箇所以上形成され、前記可撓部が屈曲されて、前記各リジット基板部の各リジッド基板に実装される各半導体チップが順次折畳まれるように積層されるととを特徴とする。

【0011】上記請求項2に従属する請求項6に記載の発明では、前記リジッドフレックス基板において、前記可撓部が前記第1のリジッド基板部の少なくとも2辺に形成され、該可撓部を介して、前記第2のリジッド基板部が前記第1のリジッド基板部に対して少なくとも2方向に形成され、前記可撓部が屈曲されて、前記各リジッド基板部の各リジッド基板に実装される各半導体チップが前記第1のリジット基板部上で順次折畳まれるように積層されることを特徴とする。

【0012】請求項1乃至6に従属する請求項7に記載の発明では、前記第1のリジッド基板部の前記外部接続端子が形成される他方のリジッド基板には外部接続端子形成用の端子バッドおよび配線パターンが形成され、前記各半導体チップが実装される一方のリジッド基板、および前記第2のリジッド基板部の前記リジッド基板には前記半導体チップ実装用の接続端子バッドおよび配線パターンが形成され、前記フレキシブル基板には所定の配線パターンが形成されて、前記各リジッド基板のの記端子パッドおよび接続端子パッドが前記フレキシブル基板の前記配線パターンを介して相互に電気的に接続されていることを特徴とする。

[0013]請求項8に記載の発明では、屈曲自在なフ レキシブル基板と、このフレキシブル基板の1つの第1 の領域の両面を挟み込む2枚のリジッド基板を備える第 1のリジッド基板部と、前記フレキシブル基板の少なく とも1つの第2の領域の、少なくとも一方の面上に配設 されるリジッド基板を備える第2のリジッド基板部とか 40 ら構成されるリジッドフレックス基板を複数連結したシ ート状の集合基板を用い、前記集合基板の前記各リジッ ドフレックス基板における、前記第1のリジッド基板部 の、前記第2のリジッド基板部における前記リジッド基 板と同じ側の一方のリジッド基板上に、少なくとも1つ の第1の半導体チップを実装するとともに、前記第2の リジッド基板部の前記リジッド基板に、少なくとも1つ の第2の半導体チップを実装する半導体チップ実装工程 と、前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板にお ける、前記第1のリジッド基板部の、他方のリジッド基 50

板上に外部接続端子を形成する外部接続端子形成工程 と、前記半導体チップ実装工程および前記外部接続端子 形成工程後、前記集合基板に連結された前記各リジッド フレックス基板を個片化する個片化工程と、個片化され た前記各リジッドフレックス基板を、該リジッドフレッ クス基板の前記第1のリジッド基板部と前記第2のリジッド基板部間の前記フレキシブル基板を可撓部として、 該可撓部で屈曲させて前記各リジッド基板に実装される 前記各半導体チップを積層させて樹脂封止する封止工程 とを具備することを特徴とする。

6

【0014】請求項9に記載の発明では、屈曲自在なフ レキシブル基板と、このフレキシブル基板の1つの第1 の領域の両面を挟み込む2枚のリジッド基板を備える第 1のリジッド基板部と、前記フレキシブル基板の少なく とも1つの第2の領域の、少なくとも一方の面上に配設 されるリジッド基板を備える第2のリジッド基板部とか ら構成されるリジッドフレックス基板を複数連結したシ 、一ト状の集合基板を用い、前記集合基板の前記各リジッ ドフレックス基板における、前記第1のリジッド基板部 の、前記第2のリジッド基板部における前記リジッド基 板と同じ側の一方のリジッド基板上に、少なくとも1つ の第1の半導体チップを実装するとともに、前記第2の リジッド基板部の前記リジッド基板に、少なくとも1つ の第2の半導体チップを実装する半導体チップ実装工程 と、前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板にお ける、前記第1のリジッド基板部の、他方のリジッド基 板上に外部接続端子を形成する外部接続端子形成工程 と、前記半導体チップ実装工程および前記外部接続端子 形成工程後、前記集合基板上の前記各リジッドフレック ス基板において、前記第1のリジッド基板部を集合基板 に連結させたまま、前記第2のリジッド基板部の前記り ジッド基板を当該集合基板から裁断して分離する分離工 程と、前記各リジッドフレックス基板の前記第1のリジ ッド基板部と前記第2のリジッド基板部間の前記フレキ シブル基板を可撓部として、前記第2のリジッド基板部 が前記集合基板から分離された状態の前記各リジッドフ レックス基板を、前記可撓部でそれぞれ屈曲させて前記 各リジッド基板に実装される前記各半導体チップを積層 し、その状態で上下に対向する半導体チップ同士を接着 固定してなるモジュールを一括して樹脂モールドした 後、前記第1のリジッド基板部の前記各リジット基板を 集合基板から裁断してモジュール単位に個片化するモジ ュール形成工程と、を具備することを特徴とする。

[0015]上記請求項8又は請求項9のいずれかに従属する請求項10に記載の発明では、前記各リジッド基板にそれぞれ実装される各半導体チップは、突起電極を介して接続されるウェハレベルCSP構造を有することを特徴とする。

【0016】上記請求項9に従属する請求項11に記載の発明によれば、前記モジュール形成工程では、上下に

対向する半導体チップ同士が接着固定された複数のモジ ュールを個々に覆う金型を用い、これにより全モジュー ルを一括して樹脂モールドすることを特徴とする。

【0017】本発明による半導体装置では、リジッドフ レックス基板をフレキシブル基板からなる可撓部で屈曲 させて各リジッド基板にそれぞれ実装される各半導体チ ップを積層させて樹脂封止する。これにより、積層され た各半導体チップが固定保持されつつ気密封止される 為、耐湿性に優れた信頼性の高い半導体装置を実現で き、しかもリジッドフレックス基板を用いたことで、基 10 板の撓みや捩れがなくなる為、半導体チップ実装時の位 置ずれを防ぐことができる結果、製造歩留りの低下を回 避し得る。

[0018] また、本発明による半導体装置の製造方法 では、リジッドフレックス基板を複数連結したシート状 の集合基板を使用しているので、撓みや捩れが発生せ ず、これ故、汎用のチップマウンタや基板搬送システム に適用でき、しかも実装時の位置ずれも回避し得る結 果、製造歩留りの低下を防ぐ。さらに、集合基板には複 数のリシッドフレックス基板が配設される為、それら複 20 数のリジッドフレックス基板に一括して半導体チップ実 装、端子形成および樹脂封止するバッチ処理が実現し 得、特別な実装プロセスを用いずとも効率良くモジュー ル構造の半導体装置を製造することができ、製品コスト 低減に寄与し得るようになっている。

[0019]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態について説明する。

(1) 第1 実施例

①半導体装置10の構造

図1(イ)は第1実施例による半導体装置10の構造を 示す断面図である。この図において、1はフレキシブル 基板1aとリシッド基板1bとから形成されるリジッド フレックス基板である。リジッドフレックス基板 1 は、 同図(ロ)に図示するように、フレキシブル基板laと 複数のリジッド基板lbを備え、フレキシブル基板la の上下両面をリジッド基板 1 b で挟んだ所謂サンドイッ チ構造を成した部分と、フレキシブル基板1aが露出さ れた部分(可撓部) 1 cを有する複合基板である。

【0020】すなわち、リジッドフレックス基板1は、 フレキシブル基板1aが露出する可撓部1cで屈曲自在 となり、また可撓部1cを境にして、両側にリジッド基 板1bが上下両面に配設され、4面のリジッド基板1b を具備する。そして、可撓部 1 c を境にした一方側の、 リシッド基板1bが上下両面に配設される部分(第1の リジッド基板部11)の一方のリジッド基板1bには、 例えばウェハレベルCSP構造の半導体チップ2がフェ イスダウンによりフリップチップ実装され、他方のリジ ッド基板 1 b には格子状にハンダボール3 a を配設して 外部接続端子3が形成される。また、可撓部1 c を境に 50 なる為、チップ実装時の位置ずれを防ぐととができる結

した他方側の、リジッド基板 l b が上下両面に配設され る部分(第2のリジッド基板部12)の各リジッド基板 1 b には、同様に、例えばウェハレベルCSP構造の半 導体チップ2がフリップチップ実装される。

[0021]また、後述するように、第1のリジッド基 板部11の、一方の半導体チップ2がフリップチップ実 装される側のリジッド基板1b、及び第2のリジッド基 板部12の各リジッド基板1bには、半導体チップ実装 用の接続端子パッド、配線パターン及びフレキシブル基 板1aに形成される配線パターンに接続されるスルーホ ール等が形成され、第1のリジッド基板部11の、他方 の外部接続端子3が形成されるリジッド基板1bには、 外部接続端子形成用の端子パッド及び配線パターン及び スルーボール等が形成される。

[0022]一方、フレキシブル基板1aには、リジッ ド基板1bに接続される配線パターンやスルーホール (あるいはビアホール)等が形成され、これらにより各 、リジッド基板1bの端子バッドおよび接続端子パッドが フレキシブル基板 1 a の配線パターンを介して相互に電 気的に接続されるように構成されている。

【0023】なお、ととで半導体チップ2をウェハレベ ルCSP構造によるものとしたが、とのウェハレベルC SP構造は、ウェハ状態で半導体チップ上に絶縁層を形 成した後、再配線層を形成し、次いで突起電極(ポスト 端子) による接続用電極端子を形成した後、チップ毎に 個片化して形成したものであり、半導体チップとほぼ同 じ大きさで、且つ突起電極(ポスト端子)による接続用 電極端子の配置を比較的自由に設定可能としたものであ る。従って、半導体チップ2をウェハレベルCSP構造 30 とした場合、後述する図2に示すように、リジッド基板 1 b に形成される半導体チップ実装用の接続端子パッド をマトリクス状に配置することができ、リジッド基板 1 bの大きさを小さくすることができる。ただし、本発明 における各実施形態において、半導体チップ2の構成は とのウェハレベルCSP構造に限定されるものではな く、突起電極が形成された種々の構造による半導体チッ プを用いることができる。

[0024] こうしてチップ実装および端子形成された リジッドフレックス基板lは、可撓部lcで屈曲される 40 ととによって、各半導体チップ2を積層状態にする。と の状態で上下に対向する半導体チップ2同士を接着固定 してから、リジッド基板1bとの接合部を覆うようにリ ジッド基板1bに実装される各半導体チップ2を封止樹 脂5 にて気密封止する構造を有する。

【0025】とのようなモジュール構造にすると、積層 状態の各半導体チップ2を固定保持しつつ気密封止し得 る為、耐湿性に優れた信頼性の高い半導体装置10を実 現できる。しかも、リジッドフレックス基板1を用いた ことで、基板の撓みや捩れが大きく低減され、殆どなく

果、製造歩留りを向上させるととができる。また、リジ ッドフレックス基板1を用いると、半導体チップ2をフ リップチップ実装する面が3面となり、フレキシブル基 板100を用いた従来例(図10参照)に比べ、より高 密度実装し得るようになる。

[0026]なお、上記構成では、リジッドフレックス 基板 1 における第2のリシッド基板部もリジッド基板 1 bが上下両面に配設される構成としたが、これに限るも のではなく、少なくとも第1のリジッド基板部において 半導体チップ2がフリップチップ実装される側のリジッ 10 ド基板 1 b と同じ側にのみリジッド基板 1 b を配設する 構成とし、そこに半導体チップ2をフリップチップ実装 するようにしてもよい。

[0027] ②半導体装置10の製造方法

次に、図2~図5を参照して上記構造による半導体装置 10の製造方法について説明する。第1実施例による製 造方法では、複数のリジッドフレックス基板 1 が連設し て形成されたシート状の集合基板20を用いる。図2

(イ) (ロ) に集合基板20の構成の一例を示す。との 図に示す集合基板20は、フレキシブル基板からなるシ ート状基材21に4行3列のリジッドフレックス基板1 を一体的に連設して形成したものであり、図2(イ)は 集合基板20の平面形状を示し、図2(ロ)は集合基板 20の、リジッドフレックス基板1が形成された部分を 含む、A-A面での断面形状の要部を示す。

【0028】図に示す如く、複数のリジッドフレックス 基板1が形成される箇所においては、基材21をフレキ シブル基板1aとして用い、これをリジッド基板1bで 上下に挟んで、上下のリジット基板1bとフレキシブル 基板1aとが一体化されるとともに、2つのリジット基 30 板1b配設領域間のフレキシブル基板1aを可撓部1c とする、前記図1におけるリジッドフレックス基板1と 同様の構成が複数連結して形成される。各連結部分に は、予め開口部(以下、ミシン目)22が、各リジッド フレックス基板 1 形成箇所の周囲に設けられている。 こ れにより、後述するように、とのミシン目22に沿って 連結部分を裁断することで、容易に各リジッドフレック ス基板1を個片化し得るようになっている。

【0029】図2(ロ)に示す各リジッドフレックス基 板1において、図面上、右側のリジット基板1bとフレ キシブル基板 1 aが一体化された部分を第1のリジッド 基板部11、左側のリジット基板1bとフレキシブル基 板1aが一体化された部分を第2のリジッド基板部12 とした場合、ウェハレベルCSP構造による半導体チッ プが実装される、第1のリジッド基板部11の一方のリ ジッド基板 1 b、及び第2のリジッド基板部 12の各リ ジッド基板1bには、例えば図2(イ)に示すようなマ トリクス状の接続端子パッド1dや配線パターン、及び 図2 (ロ) に示すようなスルーホール 1 e が形成され、 また、外部接続端子3が形成される、第1のリジッド基 50 続端子パッド1d上)に、前記図3(イ)と同様にして

板部11の他方のリジッド基板1bには、外部接続端子 形成用の端子パッド 1 f や配線パターン及びスルーホー ル1eが形成される。

[0030]また、フレキシブル基板 laには配線パタ ーン1gが形成される。これらにより各リジッド基板1 bの接続端子パッド1dおよび端子パッド1fがフレキ シブル基板1aの配線パターン1gを介して相互に電気 的に接続されるように構成されている。また、図2

(イ) に示すように、基材21のリジッドフレックス基 板1形成領域外の周辺部分には、例えば銅箔からなるダ ミーパターン23が形成されている。このダミーパター ン23は、フレキシブル基板からなる基材21の剛性を 向上させ、撓みや捻れ等の変形を抑制して、製造工程に おいて汎用のチップマウンタや汎用の基板搬送システム を用いることができるようにするために設けられている ものである。但し、フレキシブル基板からなる基材21 のみで撓みや捻れ等が問題とならない場合は、ダミーバ 、ターン23を設けないようにしてもよい。

【0031】さて、とのような集合基板20を用いて半 導体装置10を製造する工程を以下に説明する。なお、 以下の各工程説明図においては、便宜上、第1のリジッ ド基板部11及び第2のリジッド基板部12を斜線部と して、単純化して示している。第1実施例の製造工程に おいては、まず図3(イ)に図示するように、集合基板 20の一面側にメタルマスクMMを載置し、その上にク リームハンダ21を供給して、スキージ22により印刷 することにより、同図(ロ)に示すように、各リジッド 基板1bの必要箇所(接続端子パッド1d上)にクリー ムハンダ21を印刷する。

【0032】次いで、図4(イ)に示すように、ハンダ 印刷された箇所(接続端子パッド1d)に、図示しない チップマウンターにより、ウェハレベルCSP構造の半 導体チップ2を搭載する。次に、この状態で集合基板2 0をリフロー炉へ搬送してリフロー処理する。 とれによ り、半導体チップ2がリジッド基板1bの各接続端子パ ッド1dにハンダ接合される。

【0033】とこで、本発明による集合基板20は、フ レキシブル基板からなるものであるが、上記のように多 くのリジッド基板1bが載置された部分を備えるため、 従来のフレキシブル基板のように撓みや捩れが発生する ことが大幅に抑制される。この結果、汎用のチップマウ ンタを用いて半導体チップ2をフェイスダウンで位置決 め搭載したり、汎用の基板搬送システムにてリフロー炉 に搬送し得るようになる。

【0034】次いで、集合基板20に配設される各リジ ッドフレックス基板 1 の一面側に搭載された半導体チッ プ2についてリフローし終えた後、図4(ロ)に示すよ うに、集合基板20の向きを反転させ、第2のリジッド 基板部12の他面側のリジット基板1bの必要箇所(接 ハンダ印刷を施し、そとに半導体チップ2を搭載した後、リフロー処理する。続いて、図4(ハ)に示すように、第1のリジッド基板部11の他面側の、外部接続端子3が形成されるリジット基板1bに設けられた外部接続端子形成用の端子パッド1fにフラックスを、例えばピンにより転写して塗布した後、フラックスが塗布された各端子パッドにハンダボール3を搭載する。この後、リフロー処理して外部接続端子3を形成する。

【0035】とうして半導体チップ2の実装および外部接続端子3の形成が完了すると、同図(二)に示すように、基材21の各リジッドフレックス基板1形成箇所の周囲に設けられているミシン目22(図2(イ)参照)に沿って基材21を裁断する。これにより、各リジッドフレックス基板1は、集合基板20からモジュール単位で個片化される。なお、裁断には、例えばNCルーター4を用いる。

[0036]次に、図5(イ)・に図示するように、モジュール単位に個片化されたリジッドフレックス基板1の第1のリジッド基板部11における、ハンダボール3に対向する側のリジット基板1bにフリップチップ実装される半導体チップ2上に、接着剤Sを塗布した後、同図(ロ)に示すように、フレキシブル基板による可撓部1cを屈曲させて各半導体チップ2を積層状態とする。この状態で上下に対向する半導体チップ2同士を接着固定する。

[0037] そして、上下に対向する半導体チップ2同士が接着固定された後、同図(ハ)に示すように、リジッド基板1bに実装される各半導体チップ2に封止樹脂5(例えばエポキシ樹脂)を、各半導体チップ2が完全に覆われるまで塗布する。この際、例えばディスペンサを用いてリジッド基板1bと半導体チップ2との接合部分にも封止樹脂5が充填されるようポッティングする。この後、封止樹脂5を熱硬化させる。これにより、図1に図示した構造の半導体装置10が製造される。

【0038】とのように、第1実施例による製造方法に よれば、フレキシブル基板からなるシート状の基材21 に複数のリジッド基板 l b が載置された複数のリジッド フレックス基板1を一体的に連設した集合基板20を使 用しているので、従来のフレキシブル基板単体を用いた 場合のように撓みや捩れが発生することが大幅に抑制さ れ、殆どなくなる為、リジッド基板を用いる場合と同様 の汎用のチップマウンタや基板搬送システムを用いると とができる。しかも、半導体チップをフェイスダウンで リジッド基板にフリップチップ実装する形態として、リ ジッド基板はフレキシブル基板に比し、搭載部の平坦 度、寸法の安定性に優れるため、実装時の位置ずれも回 避し得る結果、製造歩留りを向上させることができる。 【0039】さらに、集合基板20には複数のリジッド フレックス基板 1 が配設される為、それら複数のリジッ ドフレックス基板1に一括してチップ実装および端子形 50

成するバッチ処理が実現し、特別な実装プロセスを用いずとも効率良くモジュール構造の半導体装置10を製造することができ、製品コスト低減に寄与し得る、という効果も奏する。

12

【0040】(2)第2実旋例

次に、図6~図7を参照して第2実施例について説明する。なお、これらの図において、上述した第1実施例と共通する要素には同一の番号を付している。上述の第1 実施例では、集合基板20の基材21をミシン目22に沿って裁断して、形成された各リジッドフレックス基板1をモジュール単位に個片化し、個片化されたリジッドフレックス基板1を可撓部1cで屈曲させて各半導体チップ2を積層し、その状態で上下に対向する半導体チップ2同士を接着固定してからディスペンサによるポッティングにより各半導体チップ2に樹脂封止する態様とした。

【0041】 これに対し、第2実施例では、集合基板2 0に形成された各リジッドフレックス基板1において、 一方の第1のリジッド基板部11を集合基板20の基材 21に連結させたまま、他方の第2のリジッド基板部1 2をミシン目22で裁断して基材21から分離し、可撓 部1cを屈曲させて各半導体チップ2を積層し、上下に 対向する半導体チップ2同士を接着固定してから各半導 体チップ2を一括して樹脂モールドした後、個片化する ことを特徴としている。

【0042】すなわち、図6(イ)に図示するように、上述の第1実施例と同様の実装プロセスによって集合基板20に配設される各リジッドフレックス基板1に半導体チップ2を実装するとともに、外部接続端子3を形成する。次いで、同図(ロ)に示すように、各リジッドフレックス基板部1の一方の、外部接続端子3が形成される側の第1のリジッド基板部11を集合基板20の基材21に連結させたまま、他方の第2のリジッド基板部12の周囲を、例えばNCルーター4によりミシン目22で裁断して集合基板20の基材21から分離する。次いで、同図(ハ)に示すように、可撓部1cを屈曲させて各半導体チップ2同士を接着固定する。

【0043】 この後、同図(二)に示すように、トランファモールド用の金型7を集合基板20上に装着し、エポキシ等のモールド樹脂材6を金型7のキャビティ部7に注入する。注入したモールド樹脂材を熱硬化させた後、金型7を取り外すと、同図(ホ)に示すように、各モジュールが一括して樹脂モールドされる。そして、各リジッドフレックス基板1において、集合基板20の基材21に連結させたままの第1のリジッド基板部11の周囲をミシン目22に沿って裁断することで図7に図示する構造の半導体装置10が形成される。

[0044]以上のように、第2実施例による製造方法では、上述の第1実施例と同様、汎用のチップマウンタ

や基板搬送システムに適用可能であり、製造歩留りの低下も防ぐことが出来る上、集合基板20上に形成される複数のモジュールを一括して樹脂モールドする為、効率良くモジュール構造の半導体装置10を製造し得るようになり、製品コスト低減に寄与し得る。

[0045]なお、本実施例では、可撲部1cの屈曲に応じて上下に対向し、下部側となる第1のリジッド基板部11の各リジット基板1bと上部側となる第2のリジッド基板部11の各リジッド基板1bの寸法、形状を同一のものとしていたが、これに替えて、下部側の各リジュト基板1bの大きさを上部側のそれより大きくするようにしてもよい。このように、下部側のリジット基板1bを上部側より大きくすると、トランスファーモールドに用いる金型7の形状を簡略化でき、しかも集合基板20への金型装着が容易になる、という利点が得られる。[0046](3)変形例

次に、図8~図9を参照して変形例について説明する。 上述した第1および第2実施例では、屈曲自在な可撓部 1 cを隔てて両側に1つの第1のリジッド基板部11と 1つの第2のリジッド基板部12を具備するリジッドフレックス基板1を用いてマルチチップモジュールを形成する構造例について言及したが、これに限らず、1つの第1のリジッド基板部11を備えるとともに、複数の第2のリジッド基板部12を複数の可撓部1cを介して連結したリジッドフレックス基板1を用いてマルチチップモジュールを形成することもできる。

【0047】例えば、図8(イ)に図示するように、下面に外部接続端子3が形成される1つの第1のリジッド基板部11と、3つの可撓部1c-1~1c-3を介して縦続的に連結した3つの第2のリジッド基板部12を備えるリジッドフレックス基板1を用い、これら可撓部1c-1~1c-3を順番に屈曲させれば、同図(ロ)に示すように、各リジット基板1bにフリップチップ実装される半導体チップ2が順次折畳まれるように積層され、モールド樹脂材6で封止された、7層構造のマルチチップモジュールを形成することができる。

【0048】また、図9(イ)および、そのB-B面での断面図を示す同図(ロ)に図示するように、下面に外部接続端子3が形成される第1のリジッド基板部11の周囲4辺に可撓部1c-1~1c-4を介して第2のリジッド基板部12-1~12-4を連結したリジッドフレックス基板1を用い、これら可撓部1c-1~1c-4を順番に屈曲させれば、同図(ハ)に示すように、各リジッド基板1bにフリップチップ実装される各半導体チップ2が順次折畳まれるように積層され、モールド樹脂材6で封止された、9層構造のマルチチップモジュールを形成することができる。

[0049] との場合、第2のリジッド基板部12-1 2のリジッド基板部が第1のリジッド基板部に対して少 ~12-4の各リジッド基板1bに実装される各半導体 なくとも2方向に形成されたリジッドフレックス基板を チップ2と外部接続端子3との間の、可撓部を介する配 50 用い、これら可撓部が屈曲されて、各リジッド基板に実

線長を短縮することができるため、電気的特性を向上させることができる。また、上記各実施形態においては、 積層された各半導体チップ2を接着剤で固定し、その 後、封止樹脂5またはモールド樹脂6により封止を行う 構成としたが、これに限らず、例えば、積層された各半 導体チップ2を仮止め冶具でクリップして仮止めし、封 止樹脂5またはモールド樹脂6の硬化後、これを取り外 すようにしてもよい。さらに高密度実装する場合には、 例えば図8および図9に図示した折畳み形態を組合せる 等、様々なアレンジが可能であることは言うまでもな い。

14

[0050]

[発明の効果]請求項1に記載の発明によれば、屈曲自 在なフレキシブル基板と、とのフレキシブル基板の両面 を挟み込む2枚のリジッド基板を備える第1のリジッド 基板部と、フレキシブル基板の少なくとも一方の面上に 配設されるリジッド基板を備える少なくとも1つの第2 のリジッド基板部とから構成されるリジッドフレックス 基板を備え、第1のリジッド基板部の一方のリジッド基 板および第2のリジッド基板部のリジッド基板上に半導 体チップが実装されて、第1のリジッド基板部の他方の リジッド基板上に外部接続端子が形成され、リジッド基 板を用いている為、基板の撓みや捩れがなくなり、チッ ブ実装時の位置ずれを防ぐことができる結果、製造歩留 りを向上させることができる。請求項2に記載の発明に よれば、リジッドフレックス基板をフレキシブル基板か らなる可撓部で屈曲させて各リジッド基板にそれぞれ実 装される各半導体チップを積層させて樹脂封止するの で、積層された各半導体チップが固定保持されつつ気密 封止され、これにより耐湿性に優れた信頼性の高い半導 体装置を実現できる。請求項3に記載の発明によれば、 各リジッド基板に、突起電極を具備するウェハレベルC SP構造の半導体チップをフリップチップ実装するの で、髙密度実装するととができる。請求項4に記載の発 明によれば、可撓部の屈曲に応じて上下に対向するリジ ット基板の内、下段側に位置するリジット基板を上段側 より大きくすると、トランスファーモールドに用いる金 型の形状を簡略化でき、しかも集合基板への金型装着が 容易になる、という利点が得られる。請求項5に記載の 発明では、可撓部が2箇所以上形成され、該可撓部を介 して第2のリジッド基板部が第1のリジッド基板部に対 して従属的に2箇所以上形成されてなるリジッドフレッ クス基板を用い、これら可撓部が屈曲されて、各リジッ ト基板に実装される各半導体チップが順次折畳まれるよ うに積層されるので、髙密度実装することができる。請 求項6に記載の発明では、可撓部が第1のリジッド基板 部の少なくとも2辺に形成され、該可撓部を介して、第 2のリジッド基板部が第1のリジッド基板部に対して少 なくとも2方向に形成されたリジッドフレックス基板を

15 装される各半導体チップが順次折畳まれるように積層さ れるので、高密度実装することができる。請求項7に記 載の発明によれば、リジッドフレックス基板における外 部接続端子が形成されるリジッド基板には外部接続端子 形成用の端子パッドおよび配線パターンが形成され、各 半導体チップが実装される各リジッド基板には半導体チ ップ実装用の接続端子バッドおよび配線バターンが形成 され、フレキシブル基板には所定の配線パターンが形成 されて、各リジッド基板の端子パッドおよび接続端子パ ッドがフレキシブル基板の配線バターンを介して相互に 10 ある。 電気的に接続されている為、各リジッド基板に実装され る各半導体チップと外部接続端子とが相互に電気的に接 続されたマルチチップモジュールを形成することができ る。請求項8、9に記載の発明によれば、マルチチップ モジュールの製造工程において、・リジッドフレックス基 板を複数連結したシート状の集合基板を使用しているの で、撓みや捩れが発生せず、これ故、汎用のチップマウ ンタや基板搬送システムに適用でき、しかも実装時の位 置ずれも回避し得る結果、製造歩留りを向上させること かできる。さらに、集合基板には複数のリジッドフレッ 20 1a フレキシブル基板 クス基板が配設される為、それら複数のリジッドフレッ クス基板に一括してチップ実装、端子形成および樹脂封 止するバッチ処理を実現し得、特別な実装プロセスを用 いずとも効率良くモジュール構造の半導体装置を製造す ることができ、製品コスト低減に寄与することができ る。請求項11に記載の発明によれば、上下に対向する 半導体チップ同士が接着固定された複数のモジュールを 個々に覆う金型を用い、これにより全モジュールを一括 して樹脂モールドするので、効率良くモジュール構造の

寄与することができる。

* 【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例による半導体装置10の構造を示す 断面図である。

【図2】集合基板20の一例を示す平面図である。

【図3】第1実施例による半導体装置の製造工程を説明 するための断面図である。

【図4】図3に続く製造工程を説明するための断面図で

【図5】図4に続く製造工程を説明するための断面図で

【図6】第2実施例による半導体装置の製造工程を説明 するための断面図である。

【図7】第2実施例による半導体装置10の構造を示す 断面図である。

【図8】変形例を示す図である。

【図9】変形例を示す図である。

【図10】従来例を示す断面図である。

【符号の説明】

1 リジッドフレックス基板

1b リジッド基板

lc 可接部

2 半導体チップ

3 ハンダボール

5 封止樹脂

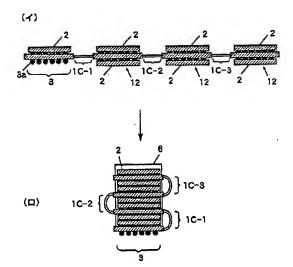
6 モールド樹脂材

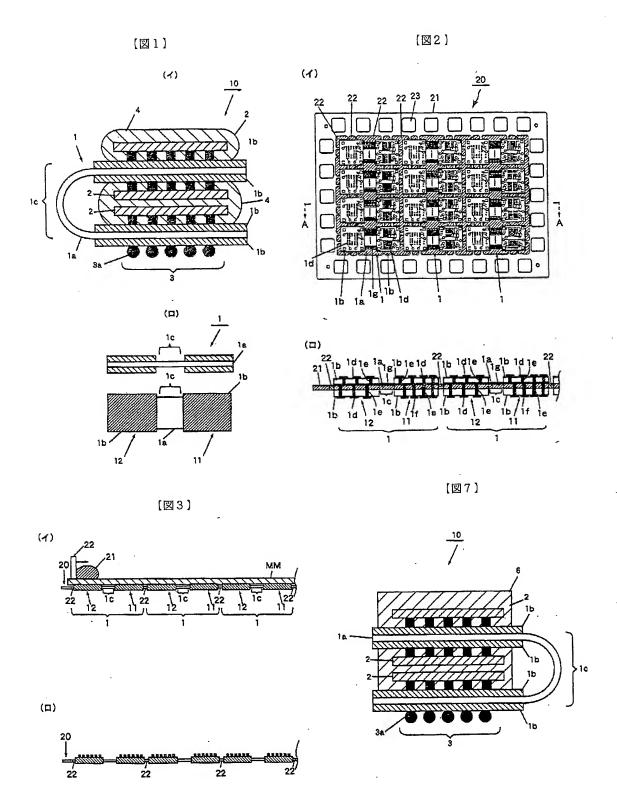
20 集合基板

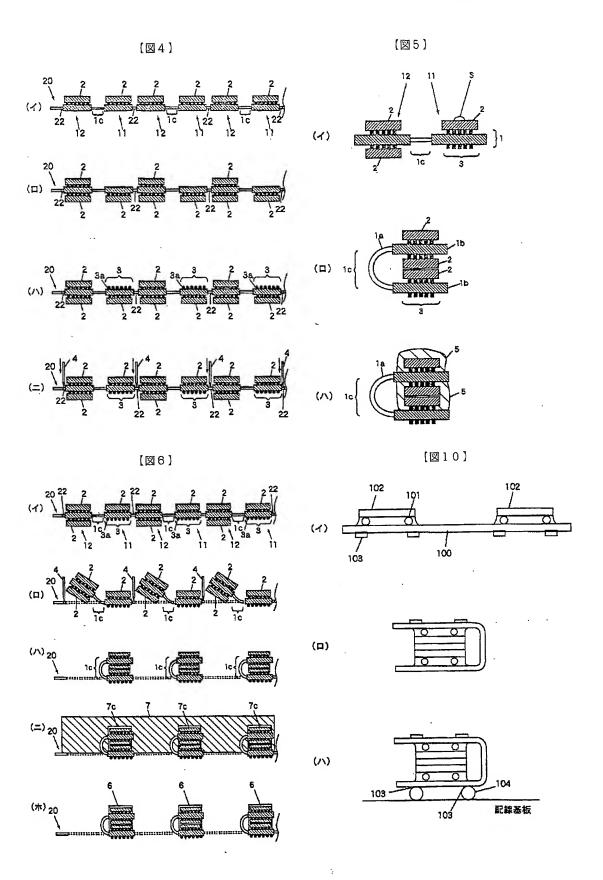
21 リジッド基材

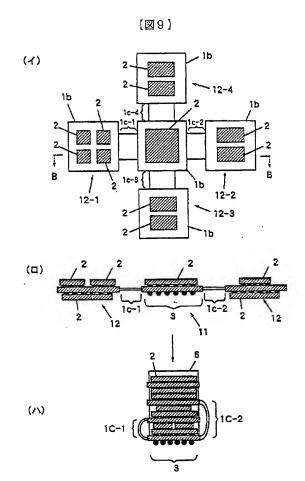
半導体装置を製造し得るようになり、製品コスト低減に 30 22 ミシン目

[図8]









フロントページの続き

(72)発明者 根岸 祐司

東京都八王子市東浅川町550番地の1 株式会社アイ・イー・ピー・テクノロジーズ内

(72)発明者 脇坂 伸治

東京都八王子市東浅川町550番地の 1 株式会社アイ・イー・ピー・テクノロジーズ内

Fターム(参考) 5F061 AA01 CA04 CA21